



Dr. Oscar Manuel Pérez Landeros

Investigador del Instituto de Ingeniería
Área Ingeniería Química del laboratorio Semiconductores,
Microelectrónica
LGAC: Corrosión y Materiales
Email: operez55@uabc.edu.mx
Orcid: 0000-0001-9027-8820
[Visitar perfil SCOPUS](#)

Biografía de investigación

Integrante del Laboratorio de Semiconductores Microelectrónica y Nanotecnología y técnico del Laboratorio de Microscopía Avanzada y Análisis de Fallas, especialista en la caracterización estructural de nanomateriales y el análisis de fallas de dispositivos microelectrónicos. Es ingeniero mecatrónico con especialidad en automatización y control. Enfocado al desarrollo de nuevos métodos de fabricación y caracterización de nanoestructuras de aplicación en la industria microelectrónica, desarrolla proyectos de modelado y simulación de estructuras MEMS y micro canales de flujo basado en materiales aislantes, semiconductores, metales y sustratos flexibles.

Formación académica/reconocimientos

Doctorado en Ingeniería, Universidad Autónoma de Baja California, del 2015 a 2019
Mestría en Ingeniería, Universidad Autónoma de Baja California, 2013 a 2015
SNI 1
Perfil PRODEP

Publicaciones recientes

- Landeros, O. P., Nedev, N., Alvarez, M. C., Salas, B. V., Barajas, A., Anzaldo, D. M., ... & Leon, A. A. (2018). Gold, copper and gold/copper bimetallic nanoparticles obtained by focused ion beam sputter deposition and rapid thermal annealing. *Vacuum*, 157, 166-172. (<https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2018.08.033>)
- Caro-Gutierrez, J., Gonzalez-Navarro, F. F., Perez-Landeros, O. M., Curiel-Alvarez, M. A., Valdez-Salas, B., & Radnev-Nedev, N. (2022). Inner diameter measurement of aligned TiO₂ nanotubes by computational image analysis. *Applied Physics A*, 128(2), 1-13. (<https://doi.org/10.1007/s00339-021-05242-w>)
- Castillo-Saenz, J., Nedev, N., Valdez-Salas, B., Curiel-Alvarez, M., Mendivil-Palma, M. I., Hernandez-Como, N., Martinez-Puente M., Mateos D., Perez-Landeros O., & Martinez-Guerra, E. (2021). Properties of Al₂O₃ Thin Films Grown by PE-ALD at Low Temperature Using H₂O and O₂ Plasma Oxidants. *Coatings*, 11(10), 1266. (<https://doi.org/10.3390/coatings11101266>)
- Castillo-Saenz, J., Nedev, N., Valdez-Salas, B., Curiel-Alvarez, M., Mendivil-Palma, M. I., Hernandez-Como, N., Martinez-Puente, M., Mateos, D., Perez-Landeros, O. & Martinez-Guerra, E. (2021). Properties of Al₂O₃ Thin Films Grown by PE-ALD at Low Temperature Using H₂O and O₂ Plasma Oxidants. *Coatings*, 11(10), 1266. (<https://doi.org/10.3390/coatings11101266>)

- Curiel, M., Nedev, N., Paz, J., Perez, O., Valdez, B., Mateos, D., Arias, A., Nesheva, D., Manolov, E., Nedev, R. & Dzhurkov, V. (2019). UV Sensitivity of MOS structures with silicon nanoclusters. Sensors, 19(10), 2277.(<https://doi.org/10.3390/s19102277>)

Proyectos recientes

- Lider de Proyecto NPT: Caracterización mecánica y estructural de materiales nanoestructurados metálicos y sistemas microelectromecánicos
- basados en silicio, y polímeros flexibles.(<https://link.springer.com/article/10.1007/s10854-021-06533-x>)
- Asociado de Proyecto NPT: Herramientas para caracterización de nanomateriales mediante la aplicación innovadora del reconocimiento de patrones en imágenes